



装置型式：ZAB-8S1M

対応Wfサイズ	φ3"~φ200mm
チャンバー数	1個
チャンバー機能	片面スクラブ・スピン乾燥



LD-UnLD	マニュアル
フットプリント	W1100xD700xH1450mm
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価

- 装置コンセプト -

LAB使用に適したコンパクトなモデルから300mmウェーハに対応したモデルまでラインナップを取り揃えております。また、お客様のご希望に沿った仕様変更・オーダーメイド、Dry-in / Dry-outが可能なCMP自動装置もご提案いたします。



北川グレステック株式会社 CMP装置カタログ

北川グレステック株式会社 営業課
東京都台東区元浅草2丁目6番6号東京日産台東ビル8階
TEL:03-3844-7109 HP:www.kitagawagt.co.jp

- CMP装置ラインナップ -



装置型式：DCMシリーズ

対応Wfサイズ	チップサイズ～φ150mm
プラテンサイズ	φ380mm
LD-UnLD	マニュアル



装置型式：ARW-681MS II

対応Wfサイズ	φ3"～φ200mm
プラテンサイズ	φ610mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W1375xD855xH2200mm
ドレスサイズ	φ100mmスリーブ
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



装置型式：ARW-461M

対応Wfサイズ	φ3"～φ150mm
プラテンサイズ	φ400mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W700xD600xH1800mm
ドレスサイズ	φ195mmホイール
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



装置型式：ARW-8C1MS

対応Wfサイズ	φ3"～φ300mm
プラテンサイズ	φ810mm
LD-UnLD	マニュアル



フットプリント	W1800xD1100xH2250mm
ドレスサイズ	φ100mmスリーブ
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価